# Релаксация низкотемпературной отрицательной фотопроводимости в *p*-GaAs/Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As: Ве и глубокие ловушки вблизи гетерограницы

© Н.Я. Минина, Е.В. Богданов, А.А. Ильевский, В. Краак\*

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119992 Москва, Россия \* Институт физики, Университет им. Гумбольдта, D-1055 Берлин, Германия E-mail: min@mig.phys.msu.ru

(Поступила в Редакцию 22 марта 2006 г.)

В гетероструктурах *p*-GaAs/Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As: Ве исследована релаксация к темновому состоянию отрицательной фотопроводимости, возникающей при гелиевых температурах при облучении красным светом. Релаксационный процесс исследован при различных температурах в области существования отрицательной фотопроводимости (T < 6 K) и одноосном сжатии до 1.7 kbar. Процессы релаксации количественно хорошо описываются в рамках модели, предполагающей наличие вблизи гетерограницы глубоких донороподобных ловушек с низкой величиной термоактивационного барьера  $E_B = 2 \pm 0.3$  meV.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 04-02-16861 и НШ № 1786.2003.2.

PACS: 73.20.Hb, 73.40.Kp

### 1. Введение

Ранее в работе [1] в гетероструктурах *p*-GaAs/ Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As наблюдалось явление низкотемпературной отрицательной фотопроводимости (ОФП), которое заключалось в уменьшении проводимости (концентрации и подвижности носителей заряда) при освещении структуры в жидком гелии красным светодиодом с энергией кванта 1.96 eV. Более подробные исследования сопротивления и эффекта Холла на аналогичных гетероструктурах в области температур 1.7-20 К при одноосном сжатии до 3.5 kbar в направлении [110] позволили обнаружить сильный термоактивационный характер ОФП и определить область ее существования:  $T < 6 \,\mathrm{K}$  [2]. Из температурной зависимости концентрации двумерных (2D) дырок в предположении существования глубоких донорных уровней вблизи гетерограницы была определена величина термоактивационного барьера  $E_B = 3 \pm 0.5$  meV, препятствующего возврату возбужденных светом неравновесных носителей на ионизованные освещением глубокие донорные уровни. Последние при этом определяют падение подвижности в условиях термоактивационной ОФП, так как, располагаясь вблизи гетерограницы, являются рассеивающими центрами для 2D-дырок в квантовой яме [3]. Согласно данным расчета, эти положительно заряженные при освещении состояния располагаются в слое на расстоянии 7-48 mm от гетерограницы и их вклад в рассеяние возрастает при одноосном сжатии. Наряду с изучением эффекта термоактивации ОФП в режиме непрерывной подсветки исследование переходных процессов после выключения освещения, происходящих в принципиально иных условиях (например, при переменной концентрации 2D-дырок в квантовой яме), может уточнить

выдвинутую в работах [1–3] модель термоактицаионной отрицательной фотопроводимости.

## 2. Эксперимент

Измерения транспортных свойств были выполнены на гетероструктуре GaAs/Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As: Ве, выращенной методом молекулярно-лучевой эпитаксии на ориентированной в направлении [001] изолирующей GaAs-подложке. Структура имела следующую последовательность слоев: на подложку GaAs напылялись сверхрешетка GaAs/AlAs для предотвращения миграции дефектов из подложки, затем буферный слой — GaAs — толщиной 700 nm; спейсер (48 nm) — нелегированный Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As; активный слой (40 nm) — Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As, легированный Ве  $(1 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3})$ ; защитный слой — GaAs (10 nm), легированный Ве  $(2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3})$ . Получаемые скалыванием прямоугольные образцы размером  $0.5 \times 0.8 \times 3.0 \,\mathrm{mm}$ были ориентированы длинной стороной вдоль одного из направлений {110}. На поверхности образцов (001) путем травления изготавливалась меза стандартной холловской конфигурации. Контактные площадки получались с помощью диффузии Au: Zn, затем к ним подваривались ультразвуковой сваркой золотые проволочки. В качестве дополнительного фактора, оказывающего сильное влияние на спектр 2D-дырок в квантовой яме, использовалось одноосное сжатие до  $P = 1.7 \,\mathrm{kbar}$  в направлении [110]. Методика создания одноосного сжатия при низких температурах описана в работе [4].

На рис. 1, *а* приведены временные зависимости концентрации 2D-дырок при различных значениях температуры. Как видно, после выключения освещения значение концентрации 2D-дырок *p* релаксирует к темновому значению  $p = 3.1 \cdot 10^{11}$  сm<sup>-2</sup>. Однако процессы релаксации концентрации 2D-дырок являются долговремен-



**Рис. 1.** Временная зависимость концентрации 2D-дырок p в линейном (a) и логарифмическом (b) масштабах по времени при P = 0. c — временная зависимость концентрации 2D-дырок p при давлении P = 1.1 kbar. Соответствующие температуры указаны около кривых. Стрелкой отмечен момент выключения освещения.

ными: при самых низких значениях температуры Т (рис. 1, a) возвращения к темновому значению за время эксперимента вообще не происходит. Темп релаксации значительно увеличивается с ростом температуры. Так, при  $T = 4.2 \,\mathrm{K}$  релаксационный процесс приводит к темновому значению концентрации уже примерно через 1 min после выключения светодиода. Все наблюдаемые релаксационные процессы существенно неэкспоненциальны, и, если предствить зависимость p(t) в логарифмическом масштабе по времени, большая часть наблюдаемых релаксационных кривых демонстрирует линейный участок (рис. 1, b). Вообще говоря, логарифмический характер релаксации указывает на сложную кинетику захвата носителей заряда в квантовой яме, которая определяется как меняющейся концентрацией, так и эффектом термоактивации. Приложение одноосного сжатия в целом не меняет характера релаксационного процесса (рис. 1, *c*).

# 3. Анализ результатов

Если высказанное в [1-3] предположение о наличии глубоких донороподобных ловушек вблизи гетерограницы справедливо, то происходящие в процессе освещения явления можно представить так, как показано на рис. 2. Ширина запрещенной зоны в Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As при T = 4.2 К составляет  $E_g = 2.1$  eV, что больше, чем энергия кванта излучения hv = 1.96 eV, используемого в эксперименте, и прямое межзонное возбуждение электрон-дырочных пар в Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As невозможно. Однако благодаря наличию на гетерогранице разрыва зон, который для валентной зоны составляет примерно 0.25 eV, возбуждение возможно, если существуют глубокие донороподобные

ловушки в спейсере Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As вблизи гетерограницы, энергия  $D_0$  которых расположена несколько ниже уровня Ферми по шкале энергий [1,2]. Во время освещения электроны с этих уровней возбуждаются в долину Г зоны проводимости  $Al_{0.5}Ga_{0.5}As$  (рис. 2, *a*), а затем под действием электрического поля, действующего на гетерогранице, попадают в квантовую яму, где рекомбинируют с 2D-дырками, что приводит к экспериментально наблюдаемому уменьшению концентрации 2D-дырок (рис. 1). После выключения освещения неравновесные электроны выше уровня Ферми (рис. 2, a, b) возвращаются обратно на ионизованные глубокие уровни и значение концентрации 2D-дырок в квантовой яме возрастает. (Этот же процесс можно интерпретировать как захват дырки из квантовой ямы и ее туннелирование обратно после выключения освещения).

Поскольку время туннелирования не зависит от температуры, оно не определяет низкий темп релаксационных процессов при T < 4.2 К, который, так же как и эффект термоактивации ОФП, связан, скорее всего, с наличием барьера  $E_B$ , препятствующего возврату неравновесных электронов на ионизованные глубокие донороподобные ловушки [2]. При этом величина барьера  $E_B$  отсчитывается от равновесного уровня Ферми  $E_F^0$ (рис. 2, *b*).

Анализ релаксационных кривых позволяет оценить величину барьера  $E_B$  [2,5]. Для описания релаксации неравновесных электронов  $n^*$  воспользуемся уравнением

$$dn^*/dt = -n^*/\tau, \tag{1}$$

где  $\tau$  — время захвата неравновесных электронов на ионизованный уровень  $D_+$  (рис. 2, b),  $n^* = p_d - p$ определяет число возбужденных центров  $D_+$  и равно



**Рис. 2.** Модельное представление эффекта термоактивационной отрицательной фотопроводимости. a — зонная структура на гетерогранице p-GaAs/Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As:Be ( $e^-$  — фотовозбужденный электрон, HH1 — основное состояние дырок в квантовой яме, темные и светлые треугольники относятся к состояниям  $D_0$  и  $D_+$  соответственно); b — схематическое представление термоактивационного барьера  $E_B$ : I — процесс оптической генерации, 2 — термический заброс через барьер.

концентрации неравновесных электронов за барьером, если  $p_d$  — исходная темновая концентрация 2D-дырок, а p — изменяющаяся в процессе релаксации концентрация 2D-дырок в квантовой яме.

В подходе, разработанном для анализа кинетических явлений в материалах с глубокими *DX*-центрами, для постоянной времени при многофононном захвате неравновесных электронов [6] справедливо выражение

$$\tau = \frac{1}{\sigma v_e n^*},\tag{2}$$

где  $\sigma = \sigma_{\infty} \exp(-E_B/kT)$  — сечение захвата при конечной температуре,  $v_e$  — скорость неравновесных электронов. В изучаемом случае полагаем  $v_e = v_F^h = Ap^{1/2}$  ( $A = \text{const}, v_F^h$  — фермиевская скорость дырок в квантовой яме). При расчетах вместо  $E_B$  следует использовать эффективный барьер  $E_C = E_B - \Delta$ , где  $\Delta$  представляет собой изменение в процессе релаксации неравновесного уровня Ферми  $E_F^h$  относительно  $E_F^0$  (рис. 2, b), в параболическом изотропном приближении  $\Delta = Bn^*$  (B — константа, в которую входят эффективные массы дырок [7]). В результате уравнение (1) приводится к виду

$$g(n^*, T) = \ln\left(-\frac{dn^*}{dt}\frac{1}{n^{*2}p^{1/2}}\right)$$
$$= \frac{Bn^*}{kT} + \left[-\frac{E_B}{kT} + \ln(\sigma_\infty A)\right].$$
(3)

онной зависимости функции  $g(n^*)$  при фиксированной температуре, которую легко построить по экспериментальным данным рис. 1, позволяет получить величину B/kT, а отсечка по оси ординат — величину

Из выражения (3) следует, что наклон концентраци-

$$h(T) = -\frac{E_B}{kT} + \ln(\sigma_{\infty}A).$$
(4)

Температурная зависимость h(T), как видно, позволяет определить барьер  $E_B$ .

Полученная в результате обработки экспериментальных данных с помощью соотношения (3) величина  $B = (5 \pm 0.2 \cdot 10^{-12} \text{ meV/cm}^2)$  оказывается весьма близкой к значению  $B = 8 \cdot 10^{-12} \text{ meV/cm}^2$ , рассчитанному теоретически в рамках приближения изотропного и параболического закона дисперсии 2D-дырок.

Температурные зависимости h, полученные для разных величин одноосного сжатия, приведены на рис. 3. Согласно соотношению (4), величина, отсекаемая функцией h ( $T^{-1}$ ) на оси ординат, будет определять  $\ln(\sigma_{\infty}A)$ , а тангенс угла наклона — величину барьера  $E_B$ . Полученное таким образом для случая P = 0 значение высоты барьера  $E_B$  составляет  $2 \pm 0.3$  meV, что хорошо согласуется с высотой барьера  $E_B = 3 \pm 0.5$  meV, определенной из данных измерений ОФП в режиме непрерывной подсветки [2].

Следует заметить, что формально возможен анализ временны́х зависимостей концентрации 2D-дырок и при одноосной нагрузке  $P \neq 0$  (рис. 1, *c*). Однако приложение одноосного сжатия приводит к сильному увеличению анизотропии поверхности Ферми 2D-дырок [8], в



**Рис. 3.** Температурная зависимость отсечки h при различных значениях одноосного сжатия. P, kbar: I = 0, 2 = 1.1, 3 = 1.7.

результате чего полученные под давлением величины барьера  $E_B$  могут не соответствовать реальности. При этом, как видно из рис. 3, приложение одноосного сжатия в используемой схеме расчета не вызывает заметного изменения высоты барьера  $E_B$ .

## 4. Заключение

Таким образом, при температурах ниже 6 К и давлениях до 1.7 kbar исследован переходный релаксационный процесс из состояния ОФП. Темп этого процесса существенно падает с понижением температуры так, что при температурах ниже 4К концентрация дырок не возвращается к темновому значению за время проведения эксперимента. Процесс неэкспоненциален по времени в результате увеличения по мере релаксации концентрации 2D-дырок и соответствующего движения уровня Ферми в квантовой яме. Анализ временных зависимостей концентрации неравновесных носителей заряда после выключения освещения с учетом только термоактивационного механизма позволяет оценить величину термоактивационного барьера  $E_B = 2 \pm 0.3$  meV, что хорошо согласуется с данными работы [2] и подтверждает справедливость выбранной модели термоактивационной ОФП с глубокими донороподобными ловушками в p-GaAs/Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As: Be. Изменения высоты барьера  $E_B$  при одноосном сжатии до 1.7 kbar не обнаружено.

## Список литературы

- [1] M.J. Chou, D.C. Tsui, G. Weinmann. Appl. Phys. Lett. **47**, 609 (1985).
- [2] Н.Я. Минина, А.А. Ильевский, В. Краак. Письма в ЖЭТФ 82, 729 (2005).
- [3] I.V. Berman, E.V. Bogdanov, A.A. Ilievsky, N.Ya. Minina, W. Kraak. Phys. Stat. Sol. (b) 241, 3410 (2004).

- [4] Н.Б. Брандт, В.С. Егоров, М.Ю. Лавренюк, Н.Я. Минина, А.М. Савин. ЖЭТФ 89, 2257 (1985).
- [5] V. Mosser, S. Conteras, J.L. Robert. Phys. Rev. Lett. 66, 1737 (1991).
- [6] P.M. Mooney. J. Appl. Phys. 67, R1 (1990).
- [7] T. Ando. J. Phys. Soc. Jap. 54, 1528 (1985).
- [8] K.I. Kolokolov, A.M. Savin, S.D. Beneslavski, N.Ya. Minina, O.P. Hansen. Phys. Rev. B 59, 7537 (1999).